

様式 10

論文審査の結果の要旨

報告番号	甲 先 第 407 号	氏 名	周 繼禹
審査委員	主査 直井 美貴 副査 永瀬 雅夫 副査 安澤 幹人 副査 敖 金平		

学位論文題目

Investigation on Integrated AlGaN/GaN Ion-Sensitive Field-Effect Transistors (集積化 AlGaN/GaN イオン感応性電界効果トランジスタに関する研究)

審査結果の要旨

AlGaN/GaN ヘテロ構造イオン感応性電界効果トランジスタ (ISFET) は、AlGaN/GaN 界面の二次元電子ガス (2DEG) によってもたらされる高電子移動度と高電子密度により、高感度かつ高速応答ができる。本論文では AlGaN/GaN ISFET の研究および集積化に関して研究した。

pH センサの良好な性能を達成するために、 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$  中 Al 組成 X (25%, 35%, 40%) の異なる構造を提案した。40% の Al 組成の試料にはバッファ層がない 7 nm の  $\text{Al}_{0.4}\text{Ga}_{0.6}\text{N}$  層のみがあり、格子不整合が大きく、2DEG 濃度が比較的低かった。25% と 35% の Al 組成を持つセンサの特性を比較した。25% の Al 組成の 16 nm バッファ層を有する障壁層の Al 組成 (35%) をもつ pH センサは、優れた表面感度 ( $S_v=56.01 \text{ mV/pH}$ ) を示した。それは 25 % の Al 組成をもつセンサ (53.94 mV/pH) より大きくなつたが、電流感度  $S_A$  (-0.095 mA/pH vs -0.102 mA/pH) では前者の方が悪くなつた。また、アルカリ溶液中で 5 回測定を行った結果、デバイスのしきい値電圧は約 -1.6 V から約 -0.8 V までシフトし、出力電流も減少した。高分解能 SEM 写真から、デバイス表面に約 100 nm の大きさの高密度六角形ピットが現れることを示し、アルカリ検出中の転位のエッチング効果を示すことが判った。XPS 検査では pH 検出測定後に Ga3d と Al2p スペクトルの強度が低下し、上部の AlGaN 薄膜で化学成分の変化が起こることを示唆した。SEM 観察の結果と似ていて、TEM 写真からも約 100 nm の大きさのボイドが観察された。EDX と組み合わせることにより、電気的性能の劣化には、アルカリ溶液での溶解と同様に AlGaN 層の酸化物への変換が起因することが判った。表面 Al 成分と溶液の反応を避けるため、3 nm の GaN キャップ層を添加した。センシング特性を維持し、さらに相互コンダクタンスを向上するため、ゲート長 2 μm、深さ 14 nm のリセスゲートを形成した。AlGaN/GaN 系 ISFET pH センサの電流感度は、リセスゲート構造とアンモニア水処理により、52.25 μA/pH から 84.39 μA/pH になり、61% 向上したことが判った。

GaN に基づくショットキーバリアダイオード (SBD) は、温度検知のために使用することができます、温度感度も異なる構造設計によって改善され得る。リセスアノードを用いた AlGaN/GaN SBD は、温度センサ用の GaN 系パワーデバイスと集積化するのに適している。固定電流での順方向電圧の温度依存性は良好な直線性を示し、約 1.0 mV/K の感度が得られた。p-NiO ガードリング構造は、アノード/GaN 界面の電界、そしてアノード端部でのフィールドクラウディングを効果的に抑制することができ、降伏電圧を約 -250 V に高めることができた。同じ材料を使うために、我々は温度と pH を同時に測定するために GaN に基づく集積化センサデバイスを設計することが期待できる。それによって、異なる温度での pH センサの測定偏差を解決する。

本研究では、AlGaN/GaN ヘテロ構造に基づき、pH センサとしての ISFET と温度センサを研究した。溶液中デバイス動作の安定性、劣化メカニズム、集積化に関して独自な見解をもたらす発見を示した。優れた成果が得られている。本論文は博士（工学）の学位授与に値するものと判定する。